# Al/Ni含能多层膜在Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷/不锈钢焊接中的应用

# 林凤洁 代 波 任 勇 张小伟 龙中敏

(西南科技大学环境友好能源材料国家重点实验室, 绵阳 621010)

文 摘 采用磁控溅射设备,生长AuSn合金做焊料层、Al/Ni含能多层膜做热量提供层,实现了不锈钢和 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>间的异质材料自蔓延高温扩散焊。利用SEM、XRD和DSC等测试手段表征AuSn合金和Al/Ni含能多层 膜的微观形貌、相成分和放热量;用万能试验机测试焊接接头的力学性能。结果表明,AuSn合金的质量比基 本达到80:20,而多层膜的层状结构清晰,反应热达到1239 J/g。焊接实验结果表明,仅使用AuSn焊料时,剪 切强度仅为46 MPa,在增加Al/Ni含能多层膜后,其剪切强度可达90 MPa,强度提高了约一倍。焊接接头的界 面显微形貌和相结构研究表明,剪切强度的增强主要是Al/Ni多层膜提供了额外能量使得界面处的反应剧烈, 陶瓷金属化层与中间层的反应加剧,形成了新的反应生成物。

**关键词** Al/Ni含能多层膜,不锈钢和Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,异质材料,自蔓延高温扩散焊 中图分类号:TG454 DOI:10.12044/j.issn.1007-2330.XXXX.XX.001

# Welding Properties of Al/Ni Energetic Multilayer Film in Heterogeneous Materials

LIN Fengjie DAI Bo REN Yong ZHANG Xiaowei LONG Zhongmin (State Key Laboratory of Environment-friendly Energy Materials, Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621010)

**Abstract** The AuSn alloy was grown by magnetron sputtering as the solder layer and the Al/Ni energetic multilayer film was used as the heat supply layer to realize the heterogeneous soldering between stainless steel and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. The morphology and basic properties of the AuSn alloy and Al/Ni energetic multilayer films were investigated by SEM, XRD and DSC. The mechanical properties of the welded joints were tested by a universal testing machine. The result shows, the mass ratio of AuSn alloy is basically 80:20, and the layered structure of the multilayer film is clear, the heat of reaction reaches 1239 J/g. Studies have shown that only AuSn solder has a shear strength of 46 MPa. After increasing the Al/Ni energetic multilayer film, the shear strength can reach 90 MPa and the strength is increased by about one time. The microstructure and phase structure of the welded joints show that the increase of shear strength is mainly due to the additional energy provided by the Al/Ni multilayer film, which makes the reaction at the interface intense, and the reaction between the ceramic metallization layer and the intermediate layer is intensified, and new reaction products formed.

**Key words** Al/Ni energetic multilayer film, Stainless steel and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Heterogeneous material, Selfpropagating high temperature diffusion welding

#### 0 引言

金属-陶瓷组合件近年来迅猛发展,在航空航天 及光电产业等领域得到越来越广泛的应用。焊接则 是生产和加工金属-陶瓷组合件的一种重要手段,然 而在焊接过程中往往需要较高的温度但焊接接头强 度低,因此研究金属-陶瓷的低温焊接技术显得尤为 重要。近年来,含能反应多层膜辅助焊接受到广泛 关注。含能反应多层膜作为一种能源材料具有以下 优点:比表面积大,放热量大、热影响区小、产物单 一、无污染等。目前,含能反应多层膜主要集中应用

收稿日期:2019-12-22

基金项目:四川省科技厅项目(2019YJ0448);国家自然科学基金(11702263)

第一作者简介:林凤洁,1993年出生,硕士研究生,主要从事先进电子薄膜制备及应用,金属与陶瓷等异质材料的焊接研究。E-mail: Lin0706116@163.com

通讯作者:代波,教授,博士研究生导师,主要从事纳米磁性材料的物理化学方法制备及物性研究、磁性复合体系中电子输运研究以及与电磁波的相互作用研究。。E-mail: daibo@swust.edu.cn

于高能换能元器件[1-3]、电子封装[4-6]、自蔓延焊 接<sup>[7-9]</sup>、自蔓延高温扩散焊等方面<sup>[10-12]</sup>。其中Al/Ni含 能反应多层膜以容易点燃、材料容易获得、反应传播 速度快等优点倍受青睐。S. Simões等人使用Ti/Al、 Ni/Ti或 Al/Ni多层膜,分别对同种的 TiAl 合金与异种 的TiAl合金的扩散焊接,研究认为多层膜的使用有 效的降低了焊接TiAl合金所需的温度、压力和时 间<sup>[13-16]</sup>。易江龙等人使用Al/Ni多层膜自蔓延焊接了 铜和氧化铝,成功焊接了铜和Al,O,陶瓷,接头强度约 为26 MPa,认为Al/Ni多层膜的应用不仅降低了铜与 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷的焊接温度,同时增大了焊接接头的力学 强度<sup>[17]</sup>。而龙中敏等人用 Al/Ni 多层膜在较低温度 下成功焊接了铜和Al,O,陶瓷,接头达到高达88 MPa 的剪切强度,有效降低了焊接的温度[18]。目前研究 方向主要是通过使用多层膜降低焊接的实验条件,对多层 膜的调制周期对焊接接头性能的影响研究较少。

本工作选择 Al/Ni 含能反应多层膜作为辅助层, 对 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷和 321 奥氏体不锈钢这两种异质材料进 行自蔓延高温扩散焊研究,通过分析 321 奥氏体不锈 钢和 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷焊接接头界面组织特点,探究不同调 制周期 Al/Ni 多层膜对焊接接头力学强度的影响。

#### 1 试验

### 1.1 母材准备

试验所用母材是表面经过抛光处理的Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷

和321奥氏体不锈钢,不锈钢尺寸为5 mm×5 mm×10 mm, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷尺寸为5 mm×7 mm×10 mm。生长薄膜前将不锈钢和陶瓷依次用丙酮、去离子水、酒精超声清洗后干燥备用。

### 1.2 母材金属化处理及焊料多层膜制备

生长薄膜所用设备是由沈阳科学仪器股份有限 公司生产的JGP-450A磁控溅射系统。首先在陶瓷 上生长约 100 nm 的 TiW 膜和 200 nm 的 Au 膜, 增大 AuSn 焊料与 Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>陶瓷间的润湿性<sup>[5,19]</sup>。然后在陶瓷 和不锈钢上分别生长AuSn薄膜作为焊料,所使用的 靶材是金片按照比例用银浆粘贴在锡靶上组成的自 制靶材,通过增减金片的数量可以方便地改变AuSn 薄膜中的金锡比例。本次实验中,生长的金锡焊料 质量比参照商用AusoSn20的比例来制备。最后在已 生长了 AuSn 焊料的样品上生长 Al/Ni 含能多层膜, Al/Ni含能多层膜由铝靶和镍靶交替溅射生长,在溅 射中,保证不锈钢侧最外层为Ni膜,而陶瓷侧最外层 是AI膜。图1是Al,0,陶瓷和321奥氏体不锈钢生长 薄膜的结构及简易焊接夹具示意图。通过文献调 研<sup>[20-21]</sup>, 调制周期在 100 nm 以下的多层膜, 在焊接后 对接头断面形貌和性能影响不大,因此本次实验选 用调制周期相差较大的40和250 nm的多层膜用于 研究。为了对比多层膜在焊接中的作用,制备了3种 样品,结构参数如表1所示。

表1 薄膜厚度参数 Tab. 1 Parameters of films

| Tub: 1 Tutumeters of mins |                                |           |                             |                                |          |      |                         |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|----------|------|-------------------------|
| 样品                        | AuSn薄膜膜厚<br>d <sub>1</sub> /µm | Al/Ni 多层膜 |                             |                                |          |      |                         |
|                           |                                | 原子比       | 単层Al薄膜厚度λ <sub>Al</sub> /nm | 单层 Ni 薄膜厚度 λ <sub>Ni</sub> /nm | 调制周期λ/nm | 周期数n | 薄膜总厚度d <sub>2</sub> /μm |
| 1                         | 7.5                            | -         | -                           | -                              | -        | -    | -                       |
| 2                         | 8                              | 1:1       | 150                         | 100                            | 250      | 16   | 4                       |
| 3                         | 8                              | 1:1       | 24                          | 16                             | 40       | 500  | 20                      |

#### 1.3 实验过程及测试

在所有薄膜制备完成后,将Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷和不锈钢 按图1所示用简易夹具装配,保证样品放置在夹具中 间,使之受力均匀,然后将装配好的夹具放入管式炉 中,在N<sub>2</sub>气氛下以5℃/min升温,达到900℃后保温 30 min,随炉冷却。使用 DEKTAK-XT 台阶仪测试薄膜的厚度; Tescan MAIA3 扫描电镜(配备能谱分析仪)观察薄膜和焊接接头的微观形貌,使用能谱分析仪检测样品的元素分布和成分含量; X'Pert PRO X射线衍射仪用来测试分析样品的物相; DSC Q2000差示扫描量







宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com XXXX年 第XX期

热仪测定多层膜的反应热;万能试验机测试焊接接头的剪切强度。

## 2 结果与讨论

### 2.1 金锡焊料和多层膜的性能表征

为了表征 AuSn 焊料薄膜和 Al/Ni 多层膜的成膜 质量,通过 SEM 和 XRD 对其进行了结构与性能表 征。如图 2(a)所示, AuSn 焊料致密平整无空隙,结 晶性好,晶粒大小均匀,能谱元素 mapping分析得到



2µm

调制周期250 nm Al/Ni多层膜SEM图

金和锡分布均匀,质量比为79.63:20.37,接近商用 AuSn 焊料质量比。图2(b)是Al/Ni多层膜测试的 XRD图,Al/Ni多层膜只包含Al和Ni单质,表明在使 用磁控溅射生长的过程中并没有因发生预混现象而 生成铝镍合金,Al、Ni薄膜均沿(111)晶面择优生长。 图2(c)和(d)显示的是扫描电镜观测的多层膜断面 结构图,可以看出,Al和Ni膜呈平直层状且界面分 明,薄膜生长紧密,均匀性较好。



(d) 调制周期40 nm Al/Ni多层膜SEM图



Fig. 2 SEM image and XRD pattern of AuSn solder and Al/Ni multilayer film

为了探究 Al/Ni 多层膜的反应热对焊接实验的 影响,对其进行了热分析测试,结果见图 3。图 3(a) 是调制周期为 250 nm 的 Al/Ni 多层膜 DSC 测试曲线,

(c)

反应放热量1239 J/g,是理论反应热(1381.6 J/g)<sup>[22]</sup> 的89.7%。ŁMAJ. 等人研究表明,Al/Ni多层膜放热 曲线存在三大放热峰,每个放热峰对应着不同的反





应,这与我们的实验结果一致<sup>[23]</sup>。图3(b)是调制周 期为40 nm的DSC曲线,放热量1017 J/g,是理论反 应热的73.6%,反应过程与250 nm的Al/Ni多层膜相 同。文献[24]表明,在薄膜沉积过程中发生Ni和Al 原子的混合,从而促进沉积样品的小区域内AlNi的 形成,在较小的调制周期薄膜中,沉积过程中形成的 AlNi更为显着,调制周期越小,预混层比例越多,反 应放热量越小。这与我们在实验中得到调制周期为 40 nm的多层膜放热量少于250 nm的多层膜的结论 一致。从两种不同调制周期的多层膜放热峰来看, 250 nm多层膜第一个反应峰的高度较小且峰形连 续,说明反应程度加剧,剧烈的反应可能会对焊接接 头的性能造成影响。

#### 2.2 Al/Ni多层膜反应扩散焊界面组织与力学性分析

图 4(a) 是样品 2 接头的微观形貌。为了易于描述,将焊接接头划分为5个区域:陶瓷区 I;靠近陶瓷 界面的反应层 II;中间的反应层 III;靠近不锈钢侧的 反应层 IV;不锈钢区 V。很明显,Ⅱ区和 IV 区呈现弯 曲的界面,AuSn焊料分布不均匀且出现裂纹和孔洞。 研究表明,调制周期较大的多层膜由于膜层较平整, 反应传播迅速,可能发生更严重的热爆炸,同时由于 Al、Ni薄膜在反应过程的面积的收缩,导致接头内部 可能出现裂纹,这不利于接头性能的稳定性<sup>[25]</sup>。该 结论与我们热分析和界面形貌分析的结果相一致。 剧烈的反应导致 AuSn 焊料在反应过程中堆积在部 分界面处,脆性的 AuSn 堆积可能减小接头的力学 强度。

对比样品2与样品3的断面SEM图,样品3接头 断面形貌较规整,如图4(b)所示。样品3整个断面 没有裂纹和孔隙,IV区的AuSn焊料均匀平直,表明 焊料和不锈钢焊接效果良好,而II区中陶瓷与反应 层的分界线弯曲交错,但厚度基本均匀,这与样品2 有很大的区别,从界面反应来看焊料和多层膜与陶 瓷在界面发生剧烈的化学反应,反应物之间相互扩 散,少量的AuSn沿着陶瓷的晶界扩散迁移,分布于 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷的晶界上,填充了陶瓷内部的孔隙,增强了 陶瓷与反应层的结合强度。铝镍元素有明显的带状 分布,AuSn焊料弥散分布于焊缝两侧及多层膜之间, 使接头的成分均匀化,将残余应力分散于接头中,增 强了接头的强度。



(a) 件而2 图4 焊接接头横断面微观形貌扫描图

Fig. 4 Scanning electron micrograph of microstructure of cross section of joint

分别对3个样品作了常温下的剪切强度测试,速 率为0.2 mm/min,剪切强度分别为46、59.5、90 MPa, 如图5所示。其中样品1从界面处断裂,由于界面层 较薄,只有几个微米厚,起不到缓冲的作用,而且 AuSn焊料的脆性较大,在力的作用下容易发生断裂。 样品2和样品3的剪切力相较样品1有大幅提高,样 品3的剪切强度甚至接近样品1的两倍。多层膜的 厚度增加,反应层的厚度也随着增加,会阶段性的缓 解残余应力,并改变了裂纹的传播方向,因此接头的 断裂形式从反应层断裂变化为从母材Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷处断 裂(陶瓷剪切强度为100 MPa左右),增大了接头的强 度<sup>[26]</sup>,剪切强度随着多层膜厚度的增加先增加后保 持不变<sup>[27-28]</sup>。而样品2扫描图中焊接界面处以及多层膜 反应区域分布的裂纹,导致剪切强度比样品3较小。



#### 3 结论

采用AuSn焊料和Al/Ni含能反应多层膜实现了 不锈钢和Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷的焊接,当多层膜厚度的增加,接 <sup>宇航材料工艺</sup> http://www.yhclgy.com XXXX年 第XX期 头的剪切强度随之增加,剪切强度从46 MPa提高到 了90 MPa。Al/Ni多层膜的调制周期影响体系放热 量,其反应的程度严重影响接头的形貌及剪切强度, 调制周期为250 nm的多层膜反应剧烈使得接头内部 存在裂纹孔隙,是造成剪切强度减小的重要因素;调 制周期为40 nm的多层接头界面致密无空隙,AuSn 焊料弥散分布于接头界面处,有效地缓解了接头内 部的残余应力,增大了接头的剪切强度,改变了接头 的断裂方式。因此,合理调整 Al/Ni多层膜的调制周 期对于不锈钢和陶瓷的焊接有重大的影响。

参考文献

[1] ZENG Q, WANG T, Li M, et al. Mechanism and characteristics on the electric explosion of Al/Ni reactive multilayer foils [J]. Applied Physics Letters, 2019, 115(9): 093102.

[2] 邱林俊, 胡云钦, 李东, 等. 基于电能的桥箔爆炸 FIRESET模型修正[J]. 火工品, 2016, (1):6-10.

QIU L, HU Y, LI D, et al. Modification of FIRESET model of exploding foil based on energy [J]. Initiators & Pyrotechnics. 2016, (1):6–10.

[3] 金晓云, 胡艳, 沈瑞琪, 等. Al/Ni纳米复合含能材料的制备及其激光点火性能研究[J]. 爆破器材, 2012, 41(3): 12-15.

JIN X, HU Y, SHEN R, et al. Preparation and laser ignition studies of Al/Ni energetic nanocomposite [J]. Explosive Materials 2012, 41(3): 12–15.

[4] ZHANG A, ZHOU Z, ZHU W, et al. Si/Si bonding based on self-propagating exothermic reaction [C]//2016 17<sup>th</sup> International Conference on Electronic Packaging Technology (ICEPT). IEEE, 2016: 1180–1184.

[5] HU S, ZHOU Z, LIU H, et al. Study on the microstructure of Si/solder/Si joint based on Al/Ni self-propagating exothermic reaction [C]//2017 18<sup>th</sup> International Conference on Electronic Packaging Technology (ICEPT). IEEE, 2017: 955–959.

[6] QIU X, WANG J. Bonding silicon wafers with reactive multilayer foils [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2008, 141(2): 476-481.

[7] 何金江,徐学礼,王越,等. Ni/Al纳米金属箔自蔓延 焊接钛/铜异种材料[J]. 焊接学报, 2015 (1): 109-112.

HE J, XU X, Wang Y, et al. Soldering titanium & copper with Ni/Al self-propagating multilayer foil [J]. Transactions of the China Welding Institution, 2015 (1): 109–112.

[8] MIYAKE S, KANETSUKI S, MORINO K, et al. Thermal property measurement of solder joints fabricated by selfpropagating exothermic reaction in Al/Ni multilayer film [J]. Japanese Journal of Applied Physics, 2015, 54(6S1): 06FP15.

[9] FAN J, SHI T, TAO X, et al. The Cu-Cu selfpropagating reaction joining with different thickness of tin [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2018, 735: 1189–1194.

[10] RHEINGANS B, SPIES I, SCHUMACHER A, et al. Joining with reactive nano-multilayers: influence of thermal properties of components on joint microstructure and mechanical performance[J]. Applied Sciences, 2019, 9(2): 262.

[11] ZHU W, WU F, WANG B, et al. Microstructural and mechanical integrity of Cu/Cu interconnects formed by self-propagating exothermic reaction methods [J]. Microelectronic Engineering, 2014, 128: 24–30.

[12] ZHANG Y, YANG Y, Diffusion bonding of Cu-Cu with Al-Ni nano multilayers [J]. Materials Transactions, 2013, 54(6): 931-933.

[13] SIMÕES S, VIANA F, RAMOS A S, et al. TEM and HRTEM characterization of TiAl diffusion bonds using Ni/Al nanolayers [J]. Microscopy and Microanalysis, 2015, 21(1): 132–139.

 $[\,14\,]$  SIMÕES S, VIANA F, RAMOS A S, et al. Characterization of TiAl diffusion bonds using Ni/Ti nanolayers  $[\,J\,].$  Microscopy and Microanalysis, 2016, 22(S4): 54–55.

[15] SIMÕES S, VIANA F, RAMOS A, et al. Microstructural characterization of dissimilar Titanium alloys joints using Ni/Al nanolayers[J]. Metals, 2018, 8(9): 715.

[16] SIMÕES S, VIANA F, RAMOS A S, et al. Diffusion bonding of TiAl to Ti6Al4V using nanolayers[J]. Journal of Materials EngineeringandPerformance, 2018, 27(10): 5064–5068.

[17] YI J, ZHANG Y, HU H, et al. Characterization of Al/ Ni nanoscale multilayer used for Transient–Liquid–Phase bonding of copper and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ceramic [J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2014, 43(11): 2593–2596.

[18] LONG Z, DAI B, TAN S, et al. Transient liquid phase bonding of copper and ceramic  $Al_2O_3$  by Al/Ni nano multilayers[J]. Ceramics International, 2017, 43(18): 17000–17004.

[19] RHEINGANS B, SPIES I, SCHUMACHER A, et al. Joining with reactive nano-multilayers: influence of thermal properties of components on joint microstructure and mechanical performance[J]. Applied Sciences, 2019, 9(2): 262.

[20] WANG J, BESNOIN E, KNIO O M, et al. Investigating the effect of applied pressure on reactive multilayer foil joining [J]. Acta Materialia, 2004, 52(18): 5265–5274.

[21] HODULOVA E, RAMOS A S, KOLENAK R, et al. Characterization of ultrasonic soldering of Ti and Ni with Ni/Al reactive multilayer deposition [J]. Welding Technology Review, 2019, 91(9): 51–57.

[22] FISCHER S H, GRUBELICH M C. Theoretical energy release of thermites, intermetallics, and combustible metals [R]. Sandia National Labs., Albuquerque, NM (US), 1998.

[23] MAJŁ, MORGIELJ, SZLEZYNGERM, et al. Effect of low and high heating rates on reaction path of Ni (V)/Al multilayer [J]. Materials Chemistry and Physics, 2017, 193: 244–252.

[24] SIMÕES S, VIANA F, RAMOS A S, et al. Intermixing in Ni/Al multilayer thin films [J]. Microscopy and Microanalysis, 2009, 15(S3): 75-76.

[25] ZHANG Y P, YI J L, LUO Z Y, et al. Structural view study on diamond and copper bonding with AlNi micro/nano multilayers[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2014, 43 (11): 2597–2601.

[26] ZHANG Y, ZOU G, LIU L, et al. Vacuum brazing of alumina to stainless steel using femtosecond laser patterned periodic surface structure [J]. Materials Science and Engineering: A, 2016, 662: 178–184.

[27] WANG J, BESNOIN E, KNIO O M, et al. Effects of physical properties of components on reactive nanolayer joining [J]. Journal of Applied Physics, 2005, 97(11): 114307.

[28] WANG J, BESNOIN E, DUCKHAM A, et al. Joining of stainless-steel specimens with nanostructured Al/Ni foils [J]. Journal of Applied Physics, 2004, 95(1): 248-256.

— 5 —